

フラットパネルディスプレイの高精細化に貢献

第8-10世代大型ガラス基板製造 **NEW** 洗浄、現像工用50nmフィルター

ウルチプリーツPK GS

1. 1本で300L/min処理可能

大型基板におけるナノレベルのコンタミ除去要求に対応するため、新たにろ過精度50nmグレードを上市いたしました。250L/minを超える高流量に対応できるナノグレード製品です。ご使用中の0.1 μ m製品から流量特性を低下させることなく50nmへろ過精度を微細化することができます。

2. ポール独自の高非対称膜技術

フィルター仕様は、表1の通りです。当社独自のウルチプリーツ技術や高非対称膜の製造技術によりろ過精度の微細化と流量特性の向上を両立しました。

表1: フィルター仕様

製品名	ウルチプリーツ PK (UPK510GS)	ウルチプリーツ PKS (UPKS310GS)
ろ過精度	50 nm	50 nm
フィルターメディア	高非対称構造ポリスルホン	高非対称構造ポリスルホン
ハードウェア	ポリプロピレン (PP)	ポリプロピレン (PP)
最高使用温度	80 °C	80 °C

3. 流量特性の向上

従来タイプの“ウルチプリーツPK”フィルターに比べて、ろ過面積が約2倍となり、ろ過精度の微細化と流量特性の向上を両立しています。さらにろ過ライフを延ばすことができメンテナンスコストを削減できます。

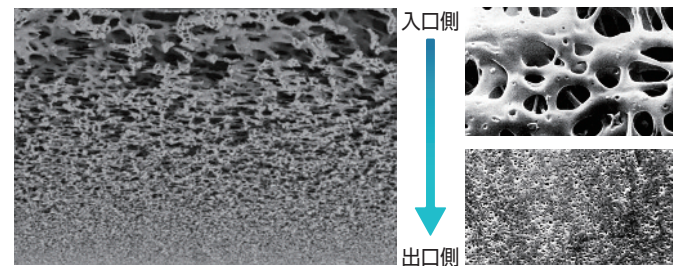


ウルチプリーツPK (UPK510GS)



ウルチプリーツPKS (UPKS310GS)

写真1: 高非対称ポリスルホン膜 (SEM写真)



断面図

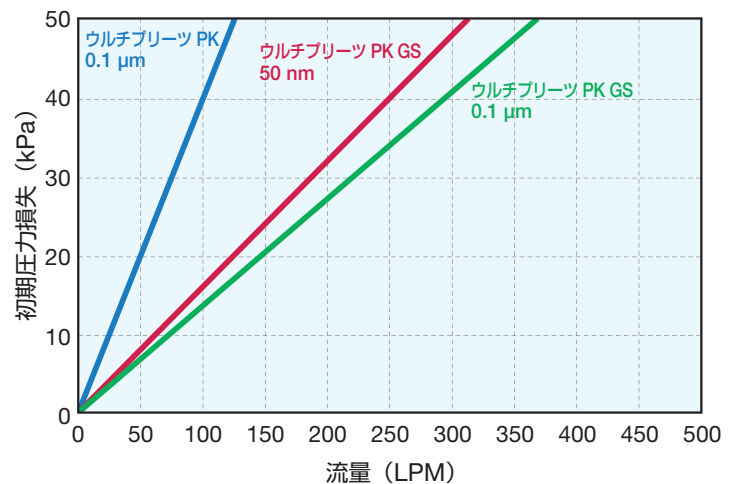


図1: UPK510GSカートリッジの流量特性比較

お問い合わせ

詳しい内容につきましてご質問がありましたら、下記までお問い合わせください。

【マイクロエレクトロニクス事業部】 TEL.03-6901-5700